(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-284619

(P2002-284619A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.⁷ 識別記号 F I デーマコート*(参考) A 6 1 K 7/00 C 4 C 0 8 3 J K M N

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願2001-84831(P2001-84831)

(22)出願日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(71)出願人 000000066

味の素株式会社

東京都中央区京橋1丁目15番1号

(72)発明者 伊森 義久

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1 味の 素株式会社アミノサイエンス研究所内

(74)代理人 100085109

弁理士 田中 政浩

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化粧料の製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、不快臭を発生させずに配合するための化粧料の製造方法の提供。 【解決手段】 下記一般式(I)で表されるシスチン誘導体と塩基性アミノ酸とを含有する化粧料の製造方法にお いて、第1段階として分子中にカルボキシル基を含有するアニオン性水溶性高分子と塩基性アミノ酸を水性媒体中で混合して中和させ、第2段階として該シスチン誘導体を混合する。

(式中、R¹ 及びR³ は水素原子、アミノカルボニル 基、アルキル基、アシル基、ヒドロキシアルキル基、又 は3-アルコキシ-2-ヒドロキシプロピル基を表し、 2個のX及び2個のYは水素原子又はアルキル基を、n 及びmは $0\sim5$ の整数を表す。A及びBは-O-又は-NH-を表し、 R^2 及び R^4 は水素原子、アルキル基、ヒドロキシアルキル基、又は3-アルコキシ-2-ヒドロキシプロピル基を表す。)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)にて表されるシスチン 誘導体と塩基性アミノ酸を含有する化粧料を製造する方 法において、第1段階として分子中にカルボキシル基を 含有するアニオン性水溶性高分子と塩基性アミノ酸を水*

(式中、R1 及びR3 はそれぞれ独立に水素原子、アミ 素原子数2~22のアシル基、炭素原子数1~22のヒ ドロキシアルキル基、またはアルコキシル基の炭素原子 数が1~22の3-アルコキシ-2-ヒドロキシプロピ ル基を表し、2個のX及び2個のYはそれぞれ独立に水 素原子または炭素原子数1~6のアルキル基を、そして n及びmはそれぞれ独立に0~5の整数を表す。A及び Bはそれぞれ独立に-O-または-NH-を表し、R2 及びR4 はそれぞれ独立に水素原子、炭素原子数1~2 2のアルキル基、炭素原子数1~22のヒドロキシアル キル基、またはアルコキシル基の炭素原子数が1~22 20 の3-アルコキシー2-ヒドロキシプロピル基を表

CO-A-R2

(式中、R1 及びR3 はそれぞれ独立に水素原子、アミ ノカルボニル基、炭素原子数1~22のアルキル基、炭 素原子数2~22のアシル基、炭素原子数1~22のヒ ドロキシアルキル基、またはアルコキシル基の炭素原子 数5が1~2203-7ルコキシ-2-1とドロキシプロピ ル基を表し、2個のX及び2個のYはそれぞれ独立に水 30 素原子または炭素原子数1~6のアルキル基を、そして n及びmはそれぞれ独立に0~5の整数を表す。A及び Bはそれぞれ独立に-O-または-NH-を表し、R2 及びR4 はそれぞれ独立に水素原子、炭素原子数1~2 2のアルキル基、炭素原子数1~22のヒドロキシアル キル基、またはアルコキシル基の炭素原子数が1~22 の3-アルコキシ-2-ヒドロキシプロピル基を表 す。)

[0003]

【従来の技術】上記一般式(I)表示のシスチン誘導体 40 として、例えばN,N'ージアセチルシスチンジメチル エステルは抗酸化作用や美白作用など皮膚化粧料として 有効な効果をもつことが知られている。しかしながら、 上記一般式(I)表示のシスチン誘導体を含む処方中に 塩基性物質として塩基性アミノ酸を含む場合、不快臭を 発生するため、使用できる化粧品に制限があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記 一般式(I)表示のシスチン誘導体と塩基性アミノ酸 を、不快臭の発生を伴わずに化粧料基材に配合してなる★50 ミトイル基、イソパルミトイル基、ステアロイル基、イ

*性媒体中で混合して中和させ、第2段階として下記一般 式(I)にて表されるシスチン誘導体を混合することを 特徴とする化粧料の製造方法。

2

※す。)

【化1】

ノカルボニル基、炭素原子数1~22のアルキル基、炭 10 【請求項2】 請求項1記載の方法によって製造された 化粧料にユーカリエキス、1-メントール及び d 1-カ ンフルから選ばれた不快臭防止成分の一種又は二種以上 を更に配合してなる化粧料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は下記一般式(I)に て表されるシスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、不快臭 を発生させずに配合してなる化粧料の製造方法に関す る。

★化粧料の製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らはかかる事情 に鑑み鋭意研究の結果、第1段階として分子中にカルボ キシル基を含有するアニオン性水溶性高分子(以下、

「カルボキシル基含有アニオン性高分子」と略記する) と塩基性アミノ酸を十分に混合して中和させ、第2段階 として上記一般式(I)表示のシスチン誘導体を混合す ることにより、該シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を、 不快臭を発生させずに配合できることを見出し、本発明 を完成するに至った。

【0006】

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳述する。 本発明に用いられる上記一般式(I)表示のシスチン誘導 体において、R¹ およびR³ としては、例えば、水素原 子、アミノカルボニル基、アセチル基、プロピオイル 基、イソプロピオル基、n-ブチロイル基、イソブチロ イル基、sec-ブチロイル基、tert-ブチロイル 基、n-アミロイル基、sec-アミロイル基、ter t-アミロイル基、イソアミロイル基、n-ヘキシロイ ル基、シクロヘキシロイル基、n-ヘプタノイル基、n オクタノイル基、2-エチルヘキシロイル基、ノニオ イル基、イソノニオイル基、デカノイル基、イソデカノ イル基、ウンデカノイル基、ラウロイル基、トリデカノ イル基、イソトリデカノイル基、ミリストイル基、パル ソステアロイル基、オレオイル基、ドコサノイル基、メ チル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert ーブチル基、n-アミル基、sec-アミル基、ter t-アミル基、イソアミル基、n-ヘキシル基、シクロ ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、2-エ チルヘキシル基、ノニル基、イソノニル基、デシル基、 イソデシル基、ウンデシル基、ラウリル基、トリデシル 基、イソトリデシル基、ミリスチル基、セチル基、イソ セチル基、ステアリル基、イソステアリル基、オレイル 10 ヒドロキシプロピル基等を挙げることができる。 基、ベヘニル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロ キシプロピル基、2-ヒドロキシイソプロピル基、2-ヒドロキシーn-ブチル基、2-ヒドロキシイソブチル 基、2-ヒドロキシーsec-ブチル基、2-ヒドロキ シーtertーブチル基、2-ヒドロキシーn-アミル 基、2-ヒドロキシーsec-アミル基、2-ヒドロキ シーtertーアミル基、2-ヒドロキシイソアミル 基、2-ヒドロキシ-n-ヘキシル基、2-ヒドロキシ シクロヘキシル基、2-ヒドロキシ-n-ヘプチル基、 2-ヒドロキシ-n-オクチル基、2-ヒドロキシ-2 20 ル基、イソセチル基、ステアリル基、イソステアリル ーエチルヘキシル基、2-ヒドロキシノニル基、2-ヒ ドロキシイソノニル基、2-ヒドロキシデシル基、2-ヒドロキシイソデシル基、2-ヒドロキシウンデシル 基、2-ヒドロキシラウリル基、2-ヒドロキシトリデ シル基、2-ヒドロキシイソトリデシル基、2-ヒドロ キシミリスチル基、2-ヒドロキシセチル基、2-ヒド ロキシイソセチル基、2-ヒドロキシステアリル基、2 - ヒドロキシイソステアリル基、2 - ヒドロキシオレイ ル基、2-ヒドロキシベヘニル基、3-メトキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-エトキシ-2-ヒドロキシ 30 -ヘプチル基、2-ヒドロキシ-n-オクチル基、2-プロピル基、3-プロピオキシ-2-ヒドロキシプロピ ル基、3-イソプロピオキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-n-ブトキシー2-ヒドロキシプロピル基、3 -イソブトキシー2ーヒドロキシプロピル基、3 - s ec-ブトキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-ter tーブトキシー2ーヒドロキシプロピル基、3-n-ア ミルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-sec-アミルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーter t-アミルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-イ ソアミルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-n-ヘキシルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-シク ロヘキシルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-n -ヘプチルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-n -オクチルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-(2-エチルヘキシル)オキシー2-ヒドロキシプロピ ル基、3-ノニルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、 3-イソノニルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3 ーデシルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーイソ デシルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーウンデ

4

オキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-トリデシルオ キシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-イソトリデシル オキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーミリスチルオ キシー2-ヒドロキシプロピル基、3-セチルオキシー 2-ヒドロキシプロピル基、3-イソセチルオキシ-2 ーヒドロキシプロピル基、3-ステアリルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3-イソステアリルオキシ-2 ーヒドロキシプロピル基、3-オレイルオキシ-2-ヒ ドロキシプロピル基、または3-ベヘニルオキシ-2-【0007】R² およびR⁴ としては、例えば、水素原 子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、 tertーブチル基、n-アミル基、sec-アミル 基、tert-アミル基、イソアミル基、n-ヘキシル 基、シクロヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル 基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、イソノニル基、 デシル基、イソデシル基、ウンデシル基、ラウリル基、 トリデシル基、イソトリデシル基、ミリスチル基、セチ 基、オレイル基、ベヘニル基、2-ヒドロキシエチル 基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシイソプ ロピル基、2-ヒドロキシーn-ブチル基、2-ヒドロ キシイソブチル基、2-ヒドロキシーsec-ブチル 基、2-ヒドロキシーtertーブチル基、2-ヒドロ キシーn-アミル基、2-ヒドロキシ-sec-アミル 基、2-ヒドロキシーtert-アミル基、2-ヒドロ キシイソアミル基、2-ヒドロキシ-n-ヘキシル基、 2-ヒドロキシシクロヘキシル基、2-ヒドロキシ-n ヒドロキシー2-エチルヘキシル基、2-ヒドロキシノ ニル基、2-ヒドロキシイソノニル基、2-ヒドロキシ デシル基、2-ヒドロキシイソデシル基、2-ヒドロキ シウンデシル基、2-ヒドロキシラウリル基、2-ヒド ロキシトリデシル基、2-ヒドロキシイソトリデシル 基、2-ヒドロキシミリスチル基、2-ヒドロキシセチ ル基、2-ヒドロキシイソセチル基、2-ヒドロキシス テアリル基、2-ヒドロキシイソステアリル基、2-ヒ ドロキシオレイル基、2-ヒドロキシベヘニル基、3-40 メトキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーエトキシー 2-ヒドロキシプロピル基、3-プロピオキシー2-ヒ ドロキシプロピル基、3-イソプロピオキシ-2-ヒド ロキシプロピル基、3-n-ブトキシ-2-ヒドロキシ プロピル基、3-イソブトキシ-2-ヒドロキシプロピ ル基、3-sec-ブトキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-tert-ブトキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-n-アミルオキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-sec-アミルオキシー2-ヒドロキシプロピ ル基、3-tert-アミルオキシ-2-ヒドロキシプ シルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-ラウリル 50 ロピル基、3-イソアミルオキシー2-ヒドロキシプロ ピル基、3-n-ヘキシルオキシ-2-ヒドロキシプロ ピル基、3-シクロヘキシルオキシ-2-ヒドロキシプ ロピル基、3-n-ヘプチルオキシ-2-ヒドロキシプ ロピル基、3-n-オクチルオキシ-2-ヒドロキシプ ロピル基、3-(2-エチルヘキシル)オキシ-2-ヒ ドロキシプロピル基、3-ノニルオキシ-2-ヒドロキ シプロピル基、3ーイソノニルオキシー2-ヒドロキシ プロピル基、3ーデシルオキシー2-ヒドロキシプロピ ル基、3-イソデシルオキシー2-ヒドロキシプロピル 基、3-ウンデシルオキシ-2-ヒドロキシプロピル 基、3-ラウリルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、 3-トリデシルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3 -イソトリデシルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、 3-ミリスチルオキシ-2-ヒドロキシプロピル基、3 ーセチルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-イソ セチルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーステア リルオキシー2-ヒドロキシプロピル基、3-イソステ アリルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーオレイ ルオキシー2ーヒドロキシプロピル基、3ーベヘニルオ キシー2-ヒドロキシプロピル基等を挙げることができ 20

【0008】上記一般式(1)表示のシスチン誘導体は、 光学活性体またはラセミ体の何れでもよいが、L体及び DL体が好ましい。また、上記一般式(I)で表される化 合物は何らかの塩の形でも好適に使用でき、例として は、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硝酸塩、 硫酸塩、リン酸塩等無機酸との塩、メタンスルホン酸 塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、1-カンファースルホン酸塩、 酢酸塩、乳酸塩、クエン酸塩、酒石酸塩、コハク酸塩、 マレイン酸塩、フマル酸塩、グルコン酸塩、グリコール 酸塩、サッカリン酸塩、安息香酸塩、脂肪酸塩、リンゴ 酸塩、ピログルタミン酸塩等の有機酸塩、アスパラギン 酸、グルタミン酸等の酸性アミノ酸塩等を挙げることが できる。これらの塩は単独で、または二種以上を組み合 わせて使用してもよい。さらにまた、一種以上の塩と遊 離体を組み合わせて使用してもよい。

【0009】本発明において、上記一般式(1)表示のシ スチン誘導体の配合量は特に制限されないが、上記した 作用を製剤に持たせるには、全組成中に0.001重量 40 %以上配合すればよく、好ましくは0.01~2重量% の範囲内で配合される。

【0010】塩基性アミノ酸としては、L-アルギニ ン、L-リジン、L-ヒスチジン等が挙げられる。塩基 性アミノ酸の配合量は、特に限定されないが、通常 0. 01~5.0重量%程度である。

【0011】本発明において、不快臭を防止する目的で 先ず塩基性アミノ酸に作用させる、カルボキシル基含有 アニオン性高分子については、分子中にカルボキシル基

ジョンを形成するものであれば、特に限定されるもので はなく、例えば、アクリル酸、メタアクリル酸、マレイ ン酸等の不飽和カルボン酸のホモポリマー、コポリマ ー、アクリル酸/酢酸ビニルコポリマー等を例示するこ とができる。これらカルボキシル基含有アニオン性高分 子の中でも、特にアクリル酸、メタアクリル酸、メタア クリル酸アルキルのうち一種以上を主成分として構成さ れる重合体が好ましく使用される。このカルボキシル基 含有アニオン性高分子について代表的なものを商品名で 10 示せば、次のとおりである。すなわち、「カーボポール 940」、「カーボポール941」、「カーボポール9 34」、「カーボポールETD-2020」、「ペミュ レンTR-1」、「ペミュレンTR-2」、「ウルトレ ズ10」(いずれもB. F. Goodrich Che mical社製)や「ハイビスワコー104」、「ハイ ビスワコー105」(いずれも和光純薬工業社製)等が 挙げられる。カルボキシル基含有アニオン性高分子の配 合量は、使用感や目的とする粘度等によって適宜決めら れるが、一般的には塩基性アミノ酸の配合量の約80~ 120重量%である。

6

【0012】水性媒体中、塩基性アミノ酸にカルボキシ ル基含有アニオン性高分子を作用させたならば、引き続 き上記一般式(I)表示のシスチン誘導体が混合される。 塩基性アミノ酸を予め、カルボキシル基含有アニオン性 高分子で中和させてから上記一般式(I)表示のシスチン 誘導体を配合することにより、該シスチン誘導体と塩基 性アミノ酸を共存させたときに発生する不快臭を著しく 軽減することができる。

【0013】本発明の方法によって製造された化粧料 30 に、さらに、不快臭防止成分としてユーカリエキス、1 ーメントール及び d 1 ーカンフルを適量配合すれば、不 快臭を完全に防止することができる。これらの不快臭防 止成分は天然で存在するものであっても合成品であって もかまわない。

【0014】更にまた、本発明に係る化粧料には、前記 必須成分の他、通常の化粧料に用いられる水性成分、粉 末、界面活性剤、油剤、保湿剤、アルコール類、pH調 整剤、防腐剤、色素、酸化防止剤、増粘剤、香料等を必 要に応じて適宜配合することができる。

【0015】

【実施例】次に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではな 11.

【 0 0 1 6 】 (実施例 1) 上記一般式(I)表示のシスチ ン誘導体であるN, N'ージアセチルシスチンジメチル エステルを用いて、表1に示す組成の美容液を製造し、 製品の不快臭について評価した。美容液の製造方法は、 表中のA成分、B成分、C成分をそれぞれ50℃に加熱 して攪拌溶解させた後、A成分にB成分を加えて良く攪 を含有し、水溶性のもの、あるいは水性媒体中でエマル 50 拌混合し、そこにC成分を加えて良く攪拌混合し、さら 7

にD成分を加えて良く攪拌混合することで行った。

【0017】表1から明らかなように、本発明の実施例 1は、必須成分であるカルボキシル基含有アニオン性高 分子を全く含まない試料(比較例1)と比較した場合は もとより、カルボキシル基含有アニオン性高分子を含ん* *でいても混合順序が異なる試料(比較例2、3)と比較 しても大きく不快臭が低減されていた。

[0018] 【表1】

		作	

夫谷成の1F成						
	成分名	比較例1	比較例2	比較例3	実施例1	
A	N, N' ージアセチルー					
	Lーシスチンジメチル	0.50	0.50	0.50		
	エステル					
	Lーアルギニン				0. 30	
	精製水	24. 50	24. 50	24.50	14. 70	
В	Lーアルギニン	0. 30	0.30			
	精製水	14. 70	14. 70	[
	カルボキシビニル	- 		20.00		
	ポリマー*1%水溶液			30.00	30.00	
С	N, N' ージアセチルー					
	Lーシスチンジメチル				0.50	
	エステル					
	Lーアルギニン			0.30		
	精製水			14. 70	24.50	
	カルボキシビニル		20.00			
	ポリマー*1%水溶液		30. 00			
D	精製水	残余	残余	残余	残余	
	不快臭の強さ	非常に強い	かなり強い	かなり強い	弱い	

注)*カルボキシピニルポリマー:「ウルトレズ 10」(商品名、BF Goodrich社)

【0019】(実施例2)上記一般式(1)表示のシスチ ン誘導体であるN, N'ージアセチルシスチンジメチル エステルを用いて、表2に示す組成のクリームを製造 し、製品の不快臭について評価した。クリームの製造方 法は、以下の順序で行った。

- 1. 表中のA~D成分をそれぞれ50℃に加熱して攪拌 溶解させる。
- で攪拌しながらA成分にB成分をゆっくり加えて乳化さ せる。
- 3.50℃まで冷却し、C成分を加えて良く攪拌混合 し、その後D成分加えて良く攪拌混合する。さらにE成※

※分を加えて良く攪拌混合し製品とする。

【0020】表2から明らかなように、事前にカルボキ シル基含有アニオン性高分子に対してアルギニン、ヒス チジン等の塩基性アミノ酸を混合させてからN, N'-ジアセチルシスチンジメチルエステルを配合した実施例 1及び2は、カルボキシル基含有アニオン性高分子に対 して塩基性アミノ酸とN,N'ージアセチルシスチンジ 2. A成分とB成分を80℃まで加熱し、ホモミキサー 30 メチルエステルを一度に添加した比較例に比べ、不快臭 が大きく低減されていた。

[0021]

【表2】

10

9 クリームの作成

	成	分 名	比較例	実施例1	実施例2
A 水相成分		カルボキシビニルボリマー	0. 35	0.35	0.35
	濃 グリセリン	10. 00	10.00	10.00	
	「精製水」	34. 65	34.65	34. 65	
B B		菜 種 油	12. 00	12.00	12. 00
	油相成分	トリステアリン酸 ポリグリセリル	1. 00	1. 00	1. 00
1	1	レシチン	0. 50	0. 50	0. 50
		ビタミンAバルミテート	0. 05	0.05	0.05
		L-アルギニン	0. 30	0. 30	0. 30
C添加剤		L-ヒスチジン	0.05	0. 05	0.05
	:	dl-ビロリドンカルボン酸 ナトリウム液	0. 50	0. 50	0. 50
		グリチルリチン酸 ジ カ リ ウ ム	0. 10	0. 10	0. 10
	添加剤	N. N' ージアセチルー Lーシスチンジメチル エステル	0. 50		
		一一一をサンコ	0. 10		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			0.10		
		レーロイシン	0. 10		
		精製水	残余	適量	適量
D海加		N, N' ージアセチルー Lーシスチンジメチル エステル		0. 50	0. 50
	添加剂	L-セリン		0. 10	0. 10
	· · · · · ·	L-アラニン		0. 10	0.10
		L-ロイシン		0. 10	0.10
		精製水		残余	残余
E	賦香成分	ユーカリエキス			0. 10
ᆫ		ーメントール			0. 001
	不 快	臭の強さ	かなり強い	弱い	非常に弱い

[0022]

【発明の効果】本発明により、塩基性アミノ酸を予めカルボキシル基含有アニオン性高分子で中和させてから上*

*記一般式(I)表示のシスチン誘導体を配合することにより、該シスチン誘導体と塩基性アミノ酸を共存させたときに発生する不快臭を著しく軽減することができる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4C083 AA111 AA112 AA122 AC122 AC422 AC581 AC582 AC612 AC642 AD091 AD092 AD531 AD532 AD572 AD622 CC01 CC04 CC05 DD23 DD31 EE06